

先端ICTデバイスラボ

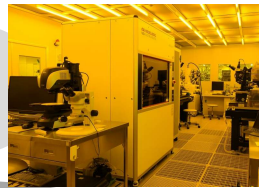
～「創りたい」を叶える研究の場を提供します～



概要

先端ICTデバイスラボは、産学官連携のデバイス研究開発拠点として開かれた施設です。先進的な設備を用いて、革新的な情報通信技術の創造を支えるデバイスの研究開発が可能です。

電子線描画装置
レーザ描画装置
紫外線露光装置



ドライエッチング
ウエットエッチング
ポリッシング装置



描く
リソグラフィ技術

削る
エッチング技術

デバイス
研究開発

計る
計測技術

付ける
成膜技術

光・THz波計測装置
プロセス評価装置
高周波計測装置



電子ビーム蒸着装置
プラズマ化学気相堆積
スパッタリング装置



特徴

- ・ 特色ある3拠点でデバイス研究開発
 1. 光デバイス施設(本部)、2. 高周波電子デバイス施設(本部)
 3. フロンティアデバイス関連施設(神戸)
- ・ 光・超高周波デバイス・超電導デバイス等の開発
- ・ 開発デバイスの高精度評価が可能な環境を準備
- ・ 環境に配慮した研究開発環境の提供
 - * 環境ISO14001認定取得(本部)

外部利用制度の利用形態

- ・ NICT研究者との共同研究型
- ・ NICT委託研究推進型
- ・ 開発成果を提供いただく研究連携型
- ・ 自由度の高い成果活用・施設等供用型

今後の展開

- ・ デバイス加工工程の高精度化
- ・ 標準デバイス作製メニューの提供
- ・ 計測、評価手法の提供

【お問合せ先】

ネットワーク研究所 先端ICTデバイスラボ
Mail : AICT.inquiry@ml.nict.go.jp

NICTオープンハウス2024

Copyright © 2024 NICT All Rights Reserved.